

F60-c

薄膜厚度测量仪



自动化薄膜厚度分布图案系统

F60-c 先进的薄膜光谱反射系统，可以很简单快速地获得薄膜的厚度及 $n&k$ ，采用 $r-\theta$ 极坐标移动平台，可以在几秒钟的时间内快速的定位所需测试的点并测试厚度，可随意选择一种或极坐标形、或方形、或线性的图形模式，也可以编辑自己需要的测试点。针对不同的晶圆尺寸，盒对盒系统可以很容易的自动转换，匹配当前盒子的尺寸。49 点的分布图测量只需耗时约 45 秒。

可测样品膜层

基本上所有光滑的、半透明的或低吸收系数的薄膜都可以测量。例如：

氧化硅	氮化硅	类金刚石 DLC
光刻胶	聚合物	聚亚酰胺
多晶硅	非晶硅	硅

相关应用

液晶显示器

- 盒厚
- 聚酰亚胺

光学镀层

- 硬涂层
- 抗反射涂层
- 滤光片

半导体制造

- 光刻胶
- 氧化物
- 氮化物
- 多晶硅

Filmetrics 优势

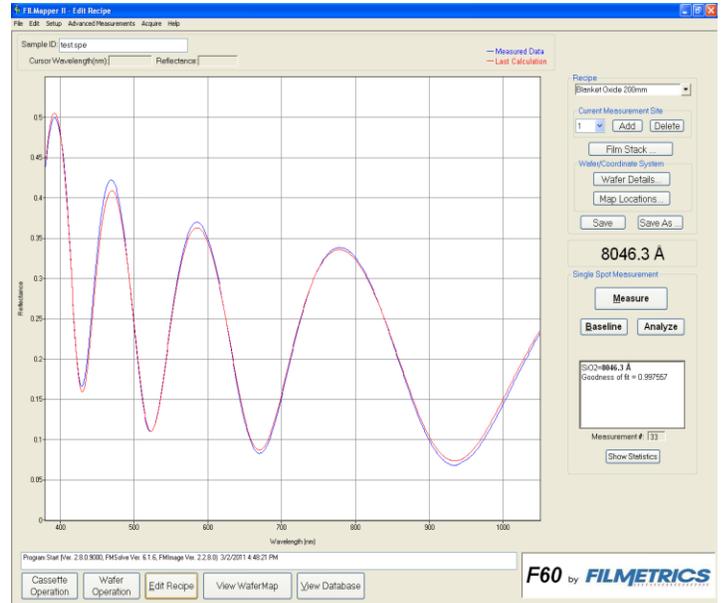
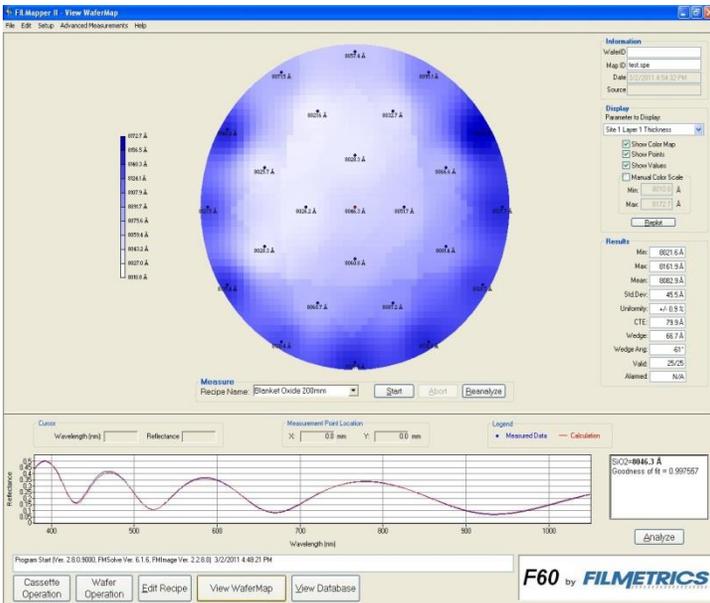
- 嵌入式在线诊断方式
- 免费离线分析软件
- 精细的历史数据功能，帮组用户有效的存储，重现与绘制测试结果

免费现场演示/支持

点几下鼠标就可以在网络上在线看到现场演示！请联系我们，我们的应用工程师会在电脑上为您演示薄膜测量是多么容易！

F60-c

薄膜厚度测量仪



21 点图案测量的循环时间是 29 秒

	F60-UV	F60-UVX	F60	F60-EXR	F60-NIR	F60-XT	F60-XXT
厚度测量范围*:	5 nm- 40 μm	5 nm- 250 μm	20 nm- 70 μm	20 nm- 250 μm	100 nm- 250 μm	0.2 μm- 450 μm	10 μm- 1 mm
测量n 和k的厚度要求*:	50 nm	50 nm	100 nm	100 nm	300 nm	2 μm	100 μm
准确度*:	大于 0.4%或	1 nm	1 nm	2 nm	2 nm	3 nm	5 nm
精度 ¹ :	0.1 nm	0.1 nm	0.1 nm	0.1 nm	0.2 nm	1 nm	1 nm
稳定性 ² :	0.07 nm	0.07 nm	0.07 nm	0.07 nm	0.12 nm	1 nm	1 nm
斑点尺寸:	标准 1.5 mm (可选配更小)					600 μm	25 μm
光源:	氙灯 & 钨卤素灯			钨卤素灯			1550nm SLED

光谱仪:	波长范围:
	200-1100 nm 200-1700 nm 380-1050 nm 380-1700 nm 950-1700 nm 1440-1690 nm 1520-1580 nm

基本要求	
晶片工艺:	F60-c300:200mm 和 300mm 晶片 F60-c200:100、125、150 和 200mm 晶片
电源要求:	100-240 VAC, 50-60 Hz, 1950W 真空泵: 25" Hg
尺寸 (cm):	41"W(103cm), 32"D(80cm) 基本系统: 59"H(148cm) FFU 选配: 72"H(180cm) 报警灯: 79"H(198cm)
重量:	基本系统: 295kg(650lbs) 风机过滤机组: 386kg(850lbs)
选配:	风机过滤机组-高效微粒空气过滤器
组件:	用户自行设定 3-4 种灯号颜色的报警方式
操作系统	
PC:	Windows XP(SP2)-Windows 8(64-bit)
Mac:	OS X Lion/Mountain Lion

提供定制化的波长组合。

* 取决于反射率。

¹ 标准偏差为一天内在 Si 基底上对厚度为 500 纳米的 SiO₂ 薄膜样品连续测量 100 次所得厚度值得标准偏差。该值为连续 20 天测量的标准偏差的平均值。

² 2σ 是基于连续 20 天, 每天在基底上对厚度为 500 纳米的 SiO₂ 薄膜样品联系测量 100 次所得厚度值上得出。



优尼康科技有限公司

- Filmetrics 薄膜厚度测量系统专业代理商

联系方式: 李先生 15900490105

盘先生 15989637322

Email: Info@unicorn-tech.com

Web: www.unicorn-tech.com

内容如有更改, 恕不另行通知 ©2014 Filmetrics, Inc

